

ИНВЕРСНАЯ НАСЕЛЕННОСТЬ И ВЫНУЖДЕННОЕ СВЕРХСВЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОБОЙНОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ

Г.П.Лека, В.А.Бродовой, Н.З.Дерикот, В.П.Пожаров

Сообщается о наблюдении стимулированного излучения возникающего при высоковольтном переключении симметричных структур In – Ga As (Cu) – In в низкоомное состояние. Первичным актом при переключении в таких структурах является генерация электронно-дырочных пар при ударной ионизации. Последующая модуляция высокоомного сопротивления базы по τ_p – механизму за время 10^{-8} сек позволяет реализовать условия быстрого снятия поля с базы. Вследствие этого при достаточно высоких плотностях токов через структуру выполняются условия, необходимые для инверсной населенности.

В настоящей работе предлагается метод получения инверсной населенности и стимулированного излучения при полевой генерации пар в кристаллах с S-образной вольт-амперной характеристикой (ВАХ) и малым временем переключения. Сообщается о наблюдении стимулированного излучения, возникающего при высоковольтном переключении симметричных структур In – Ga As (Cu) – In в низкоомное состояние. Переключение в таких структурах связано с генерацией электронно-дырочных пар при ударной ионизации и последующей модуляцией сопротивления высокоомной базы по τ_p -механизму [1].

Возможность стимулированного излучения при полевой генерации пар носителей предсказана в [2, 3]. Однако создание инверсной населенности при пробое затруднено нагревом носителей в сильном электрическом поле, снимающим вырождение [3].

Инверсную населенность при лавинном пробое можно было бы получить, подавая на кристалл высоковольтные импульсы с коротким временем спада (τ_c), обеспечивающие концентрацию неравновесных носителей, достаточную для вырождения.

Амплитуда импульса задается величиной критического поля (E_{kp}) необходимого для лавинной генерации пар, а τ_c ограничивается временем жизни неравновесных носителей (τ) при концентрациях пар n , обеспечивающих вырождение ($\tau_c << \tau$). Для получения инверсной населенности необходимо также условие: $\tau_E << \tau$, где τ_E – время релаксации по энергии.

Для GaAs при 77°K $E_{kp} = (2,8 + 4,7) \cdot 10^5$ в/см, время жизни пар относительно спонтанной излучательной рекомбинации при $n \sim 10^{17}$ см⁻³, $\tau \sim 10^{-8}$ сек [4], а $\tau_E \sim 10^{-12}$ сек. Формирование высоковольтных импульсов со столь малой длительностью спада является

весома сложной задачей. Вероятно поэтому стимулированное излучение при пробое в обычных условиях экспериментально не обнаружено.

В исследованном нами эффекте высоковольтного переключения условие быстрого снятия с базы структуры выполняется автоматически: время переключения в низкоомное состояние меньше 10^{-8} сек. Как показано ниже, при достаточно высоких плотностях токов выполняются и остальные условия, необходимые для инверсной населенности.

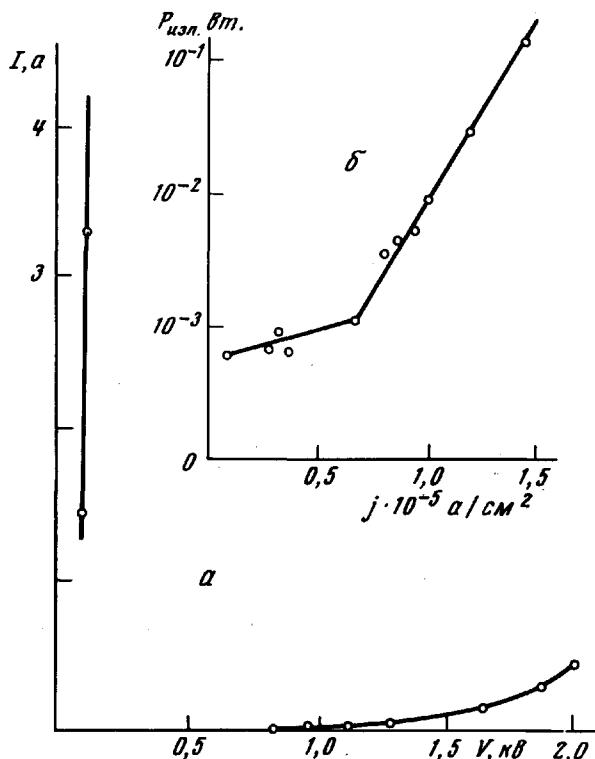


Рис. 1. а – Вольт-амперная характеристика структуры In – GaAs (Cu) – In снятая в импульсном режиме при 77° К. б – зависимость мощности излучения от плотности тока $T = 77^\circ \text{K}$

На рис. 1, а дана типичная ВАХ структуры In – GaAs (Cu) – In снятая в импульсном режиме при 77° К. При пороговом напряжении (~ 2 кв) наблюдается переключение в низкоомное состояние. После переключения остаточное напряжение на структуре не превышает 50 в, а ток определяется ограничительным сопротивлением. Вертикальный рост тока после переключения связан с образованием токового шнура [5]. О возникновении шнура свидетельствует наблюдавшееся при разрушении структуры проплавление канала диаметром 10^{-2} см, при увеличении частоты следования импульсов напряжения до 500 ци. При обычно используемых токах через структуру плотность тока в шнуре составляет $(3 + 6) \cdot 10^4 \text{ а/см}^2$, а максимальная рабочая плотность тока достигает $1,6 \cdot 10^5 \text{ а/см}^2$. При этом, как показывают оценки, концентрация электронно-дырочных пар в шнуре $n \approx (2 + 7) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, что достаточно для вырождения в GaAs при 77° К.

В момент переключения наблюдается импульс мощного собственного рекомбинационного излучения. Зависимость мощности излучения в

максимуме полосы ($P_{изл}$) от плотности тока через структуру (j) показана на рис. 1, б. При малых токах излучение слабо увеличивается с ростом j . Начиная с $j = (7 + 9) \cdot 10^4 \text{ а/см}^2$ наблюдается резкое возрастание $P_{изл}$: при увеличении j в два раза $P_{изл}$ возрастаает в 200 раз. Таким образом, для зависимости $P_{изл}$ от j характерно наличие пороговой плотности тока ($j_{пор}$).

При пороговых значениях токов наблюдается резкое изменение спектра излучения. При плотностях тока ниже пороговых регистрируется широкая полоса излучения с максимумом вблизи края собственного поглощения ($h\nu_{max}^e = 1,49 \text{ эв}$) и полушириной $\delta(h\nu)_{\frac{1}{2}} = 500 \text{ \AA}$ (рис. 2, кривая 1). При плотностях тока, превышающих пороговые, наблюдается резкое сужение полосы излучения до $\delta(h\nu)_{\frac{1}{2}} \approx 100 \text{ \AA}$ (рис. 2, кривая 2). Сужение полосы сопровождается резким увеличением интенсивности излучения. Максимум полосы при этом сдвигается в сторону меньших энергий ($h\nu_{max}^b = 1,46 \text{ эв}$). Приведенные спектры построены с учетом самопоглощения излучения; использована спектральная зависимость коэффициента поглощения, полученная в [6].

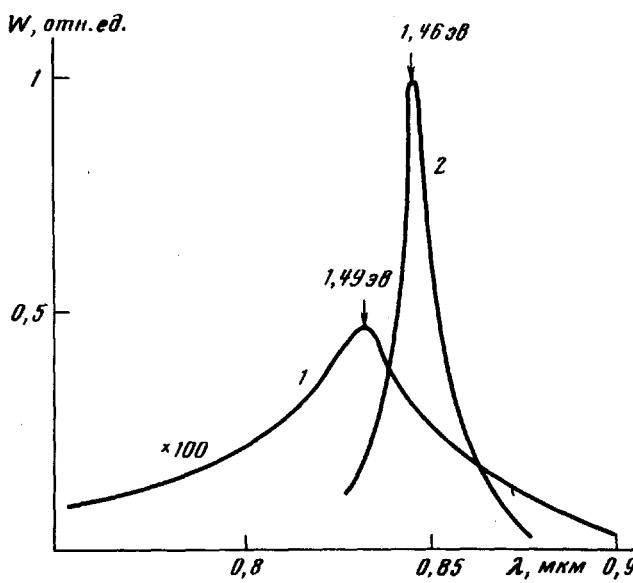


Рис. 2. Спектры излучения структуры In - GaAs (Cu) - In при разных плотностях тока j , а/см^2 : 1 - $6,5 \cdot 10^4$; 2 - $18,5 \cdot 10^4$; $T = 77 \text{ K}$

Исследование зависимости интенсивности излучения от расстояния между структурой и фотоумножителем показало, что интенсивность убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, т.е. регистрируемое излучение не является направленным.

Измерена квантовая эффективность излучения η и ее зависимость от плотности тока в шнуре (j). При j , меньших $j_{пор} = 8,5 \cdot 10^4 \text{ а/см}^2$ η составляет всего $5 \cdot 10^{-2}\%$, а при достижении пороговой плотности тока η резко возрастает до значений $\sim 40\%$ при $j \sim 2 \cdot 10^5 \text{ а/см}^2$.

Сверхлинейная зависимость интенсивности излучения от уровня возбуждения, наличие резкого порога на этой зависимости, сильное сужение спектра при пороговых токах, а также резкий рост квантовой эффективности при токах выше порогового свидетельствует о том, что

при переключении имеет место вынужденное рекомбинационное сверхсвечение [7,8].

Киевский
государственный университет
им. Т.Г.Шевченко

Поступила в редакцию
9 июля 1974 г.

Литература

- [1] В.А.Бродовой, А.Ч.Гозак, Г.П.Пека. ФТП, 8, 990, 1974; В.А.Бродовой, Н.З.Дерикот, Г.П.Пека, В.П.Пожаров. ФТП в печати.
 - [2] Н.Г.Басов, В.Н.Вул. Ю.М.Попов. ЖЭТФ, 37, 587, 1959.
 - [3] Л.В.Келдыш. ЖЭТФ, 37, 713, 1959.
 - [4] И.П.Варшни. Сб. "Излучательная рекомбинация в полупроводниках", М., изд. Наука, 1972.
 - [5] В.Л.Бонч-Бруевич, И.П.Звягин, А.Г..Миронов. Доменная электрическая неустойчивость в полупроводниках. М., изд. Наука, 1972.
 - [6] M.D.Sturge. Phys. Rev., 127, 768, 1962.
 - [7] Ж.Панков. Оптические процессы в полупроводниках. М., изд. Мир, 1973.
 - [8] А.Ярив. Квантовая электроника и нелинейная оптика. М., изд. "Советское радио", 1973.
-